

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成22年3月11日(2010.3.11)

【公表番号】特表2009-525899(P2009-525899A)

【公表日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-028

【出願番号】特願2008-554279(P2008-554279)

【国際特許分類】

B 4 1 J 2/16 (2006.01)

【F I】

B 4 1 J 3/04 1 0 3 H

【手続補正書】

【提出日】平成22年1月21日(2010.1.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリマ基板を準備するステップと、
そのポリマ基板の表面にパターン付きの付加素材層を形成するステップと、
ポリマ基板のうち付加素材層で覆われていない部分の少なくとも一部をエッチングにより除去するステップと、
を有するプリントヘッド製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載のプリントヘッド製造方法であって、
ポリマ基板の表面に直に素材を堆積させるステップと、
堆積した素材による層をパターンニングするステップと、
を実行することによりパターン付きの付加素材層を形成するプリントヘッド製造方法。

【請求項 3】

請求項 1 記載のプリントヘッド製造方法であって、
ポリマ基板の表面のうち上記付加素材層である第 1 付加素材層が形成されている面を第 1 面、他方の面を第 2 面とし、ポリマ基板の第 2 面上に別の付加素材層である第 2 付加素材層をパターン付きで形成するステップを有するプリントヘッド製造方法。